

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成20年10月23日(2008.10.23)

【公開番号】特開2004-140391(P2004-140391A)

【公開日】平成16年5月13日(2004.5.13)

【年通号数】公開・登録公報2004-018

【出願番号】特願2003-401178(P2003-401178)

【国際特許分類】

H 01 L 21/3065 (2006.01)

H 01 L 21/205 (2006.01)

【F I】

H 01 L 21/302 101 G

H 01 L 21/205

【手続補正書】

【提出日】平成20年9月9日(2008.9.9)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

プラズマが生成される処理室内で試料をプラズマ処理する方法において、前記試料が配置される試料台に高周波電圧を印加し、かつ、前記高周波電圧の電圧波形を任意の電圧で平坦化することを特徴とするプラズマ処理方法。

【請求項2】

請求項1記載のプラズマ処理方法において、前記基板電極に印加する高周波電圧の正負両電圧の少なくとも一方の電圧波形を平坦化するプラズマ処理方法。

【請求項3】

真空排気装置が接続され内部を減圧可能な処理室と、該処理室内へガスを供給するガス供給装置と、前記処理室内に設けられ被処理材を載置可能な基板電極と、該基板電極へ整合器を介して接続された高周波電源と、前記整合器内または前記基板電極と前記整合器との間に設けられた電圧波形を平坦化する電圧波形制御回路とを含むことを特徴とするプラズマ処理装置。

【請求項4】

請求項3記載のプラズマ処理装置において、前記電圧波形制御回路は前記基板電極に印加される高周波電圧の正負両電圧の少なくとも一方の電圧波形を平坦化可能であるプラズマ処理装置。